

報道発表

EUV テックと IBM がイービームイニシャチブ[®]に加盟

2023年2月28日、カリフォルニア州サンノゼ[®]発 — 電子ビーム技術を基幹とした、新しい半導体製造技術の啓蒙と推進に注力する団体であるイービームイニシャチブ[®]は本日、新たに二社が団体に加わったと発表しました。EUV 露光波長での計測装置の先駆的リーダーである EUV テック (EUV Tech) と、最先端パターンニング技術の業界リーダーでありパイオニアである IBM です。この新しいメンバーは本日の午後、サンノゼで開催中の SPIE アドバンスドリソグラフィ + パターンニング学会に合わせて開催されるイービームイニシャチブ[®]の第15回年次会合で正式に紹介されます。

イービームイニシャチブ[®]はまた、メンバー各社の製品やアプリケーションでの深層学習 (Deep Learning [DL]) の、フォトマスクからウエファ製造工程での活用事例の第3年度調査結果を発表します。メンバー13社の DL 適用一覧は www.ebeam.org でご覧いただけます。

「EUV テックと IBM がイービームイニシャチブ[®]に加盟して頂いたことに興奮を隠せません。この二社は今後、目下50社以上のイービームイニシャチブ[®]会員企業による共同作業で押し進められているフォトマスク産業界の半導体産業への貢献と教育の活動をより一層力強いものとするでしょう」と D2S 社の CEO でイービームイニシャチブ[®]のマネージングカンパニースポンサーである藤村晶が述べています。

藤村は更に、「深層学習 (DL) は半導体設計と製造工程の改善に大変重要な恩恵を提供します。数カ月前に公表しました、第11回イービームイニシャチブ[®]年次識者調査結果は、参加者の33%のみが DL の適用が2023年までに開始されるであろうと見られます。しかしながら、DL を如何にビジネスへ適用するか確信が持てない会社が居られる一方、DL を様々な方法で適用する事が必須で基礎的な事業活動であると捉えておられる会社も在るようです。

例えば、最新のリストに掲載されているメンバー会社での適用事例を見ると、DL を用いる事で、曲線図形を有するフォトマスクの製造を可能とすることや、保守作業の時期を予見した、マスク製造やフォトリソグラフィ工程の処理量を増やす事に注力されている事が良く分かります。」と述べています。



イービーム・イニシャチブ (The eBeam Initiative)とは

イービーム・イニシャチブは電子ビーム技術に基づく新しい半導体製造方法の探求の為の啓蒙・啓発活動の場を提供する公開討論の場です。その目指すものは、半導体のエコシステム全体を通じて電子ビーム技術への投資が増え続けるなか、より多くの集積回路(IC)設計開始を可能とし、またより迅速な商品化を可能とする手段の選択をする時の障害を低減することです。

会員は半導体エコシステム各方面から構成され、次にあげる各社、各機関よりなります。

aBeam Technologies; アトバンテスト(Advantest); Alchip Technologies; AMD; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; ASML; Cadence Design Systems; キヤノン(Canon); CEA-Leti; D2S; 大日本印刷 (Dai Nippon Printing); EQUIcon Software GmbH Jena; ESOL; EUV Tech; Fractilia; Fraunhofer IPMS; 富士通セミコンダクター (Fujitsu Semiconductor); GenSys GmbH; GLOBALFOUNDRIES (GF); Grenon Consulting; 日立ハイテク(Hitachi High-Tech); HJL Lithography; ホロン (HOLON); HOYA; IBM; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; 日本電子 (JEOL); キオクシア (KIOXIA); KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; 日本コントロールシステム (NCS); ニューフレアテクノロジー (NuFlare Technology); Petersen Advanced Lithography; Photonics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; タスミット (TASMIT); 東京エレクトロン(TEL); ツール(TOOL); 凸版フォトマスク(Toppan Photomask Corporation); UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH 及び ZEISS です。電子産業界に属する会社・機関であればどなたでもイービームイニシャチブの会員におなりいただけます。詳しくは www.ebeam.org をご覧下さい。

報道関係の方の本件へのお問い合わせ:

オープン スカイ コミュニケーションズ (Open Sky Communications)

デイヴィット モレノ (David Moreno)

電話: +1-415-519-3915 (米国)

電子メール: dmoreno@openskypr.com

以上